This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



(a) Int Cl.⁶: C 03 C 3/091 C 03 C 3/093



DEUTSCHES

der internationalen Anmeldung mit der

(B) Veröffentlichungsnummer: WO 97/11920
in deutscher Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 int. Pat. ÜG)

② Deutsches Aktenzeichen:

196 80 967.3

PCT-Aktenzeichen:

PCT/JP96/02751

PCT-Anmeldetag:PCT-Veröffentlichungstag:

25. 9.96 3 4.97

Veröffentlichungstag der PCT-Anmeldung in deutscher Übersetzung:
 4. 12. 97

③ Unionsprioritāt:

7/276760

28.09.95 JP

7 Anmeider:

Nippon Electric Glass Co., Ltd., Otsu, Shiga, JP

⁷⁴ Vertreter:

RA u. PA Volkmar Tetzner; PA Michael Tetzner; RA Thomas Tetzner, 81479 München

② Erfinder:

Miwa, Shinkichi, Otsu, Shiga, JP

Alkalifreies Glassubstrat

Alkalifreies Glassubstrat

5

15

20

25

30

Die vorliegende Erfindung betrifft ein alkalifreies Glassubstrat zur Verwendung als Substrat für eine Anzeigeeinheit, beispielsweise eine Flüssigkristallanzeigeeinheit oder eine EL-Anzeigeeinheit, für einen Filter, einen Sensor usw.

Bisher wurde üblicherweise ein Glassubstrat als Substrat für eine flache Anzeigetafel, wie etwa eine Flüssigkristallanzeigeeinheit, für einen Filter, einen Sensor oder ähnliches verwendet.

Auf der Oberfläche eines derartigen Glassubstrats werden eine lichtdurchlässige leitfähige Schicht, eine Isolierschicht, eine Halbleiterschicht und eine Metallschicht aufgebracht und mit Hilfe von photolitographischen Ätzverfahren (Photo-Ätzen) verschiedene Schaltkreise bzw. Muster ausgeformt. Bei derartigen Aufbringungs- und Photo-Ätzungsvorgängen wird das Glassubstrat verschiedenen Wärmebehandlungen sowie chemischen Behandlungen unterzogen.

Bei einer Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeigeeinheit mit Dünnschichttransistoren (TFT) werden beispielsweise die Isolierschicht und die lichtdurchlässige, leitfähige Schicht auf das Glassubstrat aufgebracht und mittels Photo-Atzung eine Anzahl von Dünnschichttransistoren aus amorphem oder polykristallinem Silzium ausgeformt. Bei diesen Verfahren wird das Glassubstrat einer Wärmebehandlung bei einer Temperatur unterzogen, die in der Größenordnung von mehreren 100 °C liegt, sowie einer chemischen Behandlung mit verschiedenen Chemikalien, wie etwa Schwefelsäure, Salzsäure, Alkalilösung,

10

15

20

25

30

Fluorwasserstoffsäure und gepufferter Fluorwasserstoffsäure.

Gepufferte Fluorwasserstoffsäure wird neben anderen Stoffen häufig zum Ätzen der Isolierschicht eingesetzt. Die gepufferte Fluorwasserstoffsäure neigt jedoch dazu, ein Glas derart zu erodieren, daß es zu einer Oberflächentrübung kommt. Außerdem kommt es zu einer Reaktion mit einem Bestandteil des Glases und es entsteht ein Reaktionsprodukt, das das Gitter oder die Poren eines im Verfahren verwendeten Filtersiebs verstopfen oder am Glassubstrat anhaften kann.

Andererseits wird Salzsäure zum Ätzen von ITO- und Chromschichten verwendet. Die Salzsäure neigt jedoch dazu, das Glas derart zu erodieren, daß an seiner Oberfläche Verfärbungen, Trübungen und Sprünge entstehen. Es ist daher sehr wichtig, daß das verwendete Glassubstrat sowohl gegen gepufferte Fluorwasserstoffsäure als auch gegen Salzsäure widerstandsfähig ist.

Somit muß ein Glassubstrat, das in einer Aktivmatrix-Flüssigkeitsanzeigeeinheit mit Dünnschichttransistoren verwendet wird, die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- Es darf im wesentlichen kein Alkalimetalloxid enthalten, da andernfalls während der Wärmebehandlung Alkaliionen in ein bereits aufgebrachtes Halbleitermaterial diffundieren, was zu einer Beeinträchtigung der Eigenschaften der betreffenden Schicht führt.
- Die Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien muß so hoch sein, daß Chemikalien, wie etwa die verschie-

10

15

20

25

30

denen beim Photo-Atzen verwendeten Säuren und Laugen, keine Brosion verursachen.

3. Während eines Ablagerungs- oder Abkühlungsvorgangs darf es aufgrund der Wärmebehandlung nicht zu Wärmekontraktionen kommen. Aus diesem Grund muß daß Glassubstrat eine hohe Glasübergangstemperatur aufweisen. So ist beispielsweise bei den Flüssigkristallanzeigen von Dünnschichttransistoren mit polykristallinem Silizium eine Glasübergangstemperatur des Glassubstrats von wenigstens 650°C nötig, da hier Bearbeitungstemperaturen von wenigstens etwa 600°C auftreten.

Im Hinblick auf Schmelz- und Formbarkeit muß das betreffende Glassubstrat außerdem auch noch die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- 4. exzellente Schmelzbarkeit, so daß im Glas keine Fehler aufgrund schlechter Schmelzbarkeit auftreten, die das Glassubstrat beeinträchtigen würden, sowie
- 5. hoher Entglasungswiderstand, so daß während des Schmelzens und Formens keine Verunreinigungen im Glas entstehen.

In letzter Zeit werden elektronische Geräte, beispielsweise Geräte mit Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeigeeinheiten des TFT-Typs, immer häufiger auch privat genutzt. Sie sollten daher nur ein geringes Gewicht aufweisen. Dementsprechend muß auch das Glassubstrat relativ leicht sein, wozu eine Verringerung seiner Dicke
wünschenswert ist. Gleichzeitig steigt aber die Größe
derartiger elektronischer Geräte. Hierbei sind der Re-

duzierung der Dicke natürlich Grenzen gesetzt, da die Festigkeit des Glases berücksichtigt werden muß. Es ist daher nötig, die Dichte des Glases zu reduzieren, um das Gewicht des Glassubstrates zu verringern.

5

Für Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeigen des TFT-Typs wurde bisher üblicherweise alkalifreies Glasmaterial, beispielsweise Quarzglas, Barium-Borsilikat-Glas und Aluminiumsilikat-Glas verwendet, die allerdings alle ihre jeweiligen Vor- und Nachteile besitzen.

10

So weist insbesondere das Quarzglas zwar eine ausgesprochen gute chemische Widerstandsfähigkeit und eine ausgezeichnete Wärmebeständigkeit sowie eine geringe Dichte auf. Die Materialkosten sind jedoch bei Quarzglas sehr hoch.

15

20

25

Barium-Borsilikat-Glas ist unter der Warennummer 7059 von Corning im Handel erhältlich. Allerdings ist dieses Glas weniger widerstandsfähig gegen Säuren, so daß es an der Oberfläche des Glassubstrats leicht zu Umbildungen, Trübungen und Unebenheiten kommt. Darüberhinaus kann ein Elutionsbestandteil des Substrats eine chemisch Lösung verunreinigen. Außerdem besitzt dieses Glas nur eine niedrige Glasübergangstemperatur und neigt leicht zu Wärmekontraktion und wärmebedingter Formänderung. Damit ist seine Wärmebeständigkeit unzureichend. Die Dichte des Glases ist mit 2,76 g/cm³ relativ hoch.

30

Das Aluminiumsilikat-Glas ist hingegen äußerst wärmebeständig. Allerdings weisen die meisten im Handel erhältlichen Glassubstrate eine relativ schlechte Schmelzbarkeit auf und sind für die Massenfertigung ungeeignet. Daneben besitzen die meisten dieser Glassubstrate eine hohe Dichte von wenigstens 2,7 g/cm³ und eine relativ geringe Widerstandsfähigkeit gegen gepufferte Fluorwasserstoffsäuren. Zur Zeit ist kein Glassubstrat bekannt, daß alle notwendigen Eigenschaften besitzt.

10

5

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein alkalifreies Glassubstrat zu beschreiben, daß alle oben genannten Eigenschaften 1. bis 5. und eine Dichte von 2,6 g/cm³ oder weniger aufweist.

Ein alkalifreies Glassubstrat gemäß der vorliegenden Erfindung besteht im wesentlichen aus den folgenden Gewichtsanteilen: 58.0 bis 68.0 % SiO_2 , 10.0 bis 25.0 % Al_2O_3 , 3.0 bis 15.0 % B_2O_3 , 0 bis 2.9 % MgO, 0 bis 8.0 % CaO, 0.1 bis 5.0 % BaO, 0.1 bis 10.0 % SrO, 0 bis 5.0 % ZnO, 0 bis 5.0 % ZnO, 0 bis 5.0 % 0 bis 00 % 01 bis 00 % 01 bis 01 % 02 während es im wesentlichen kein Alkalimetalloxid enthält.

20

15

Es wird nun im folgenden zuerst auf die Gründe dafür eingegangen, daß das erfindungsgemäße alkalifreie Glassubstrat die genannten Bestandteile in der erwähnten Zusammensetzung enthält.

25

30

SiO₂ dient zur Ausbildung der Gitterstruktur des Glases. Wird der Gehalt an SiO₂ erhöht, so kann die Dichte leicht bis auf 2,55 g/cm³ oder darunter sinken. Deshalb ist bei der vorliegenden Erfindung ein Gehalt an SiO₂ von wenigstens 58,0 % vorgesehen. Liegt der Gehalt an SiO₂ allerdings bei über 68,0 %, so steigt die Viskosität bei hohen Temperaturen derart an, daß die Schmelzbarkeit beeinträchtigt wird. Außerdem ver-

schlechtert sich die Entglasungsneigung so erheblich, daß sich auf Entglasung zurückzuführende Verunreinigungen in Form von Cristobalit im Glas niederschlagen können. Aus diesem Grund liegt der Gehalt an SiO₂ vorzugsweise bei 58,5 bis 67,0 %.

Al₂O₃ trägt wesentlich zur Verbesserung der Wärmebeständigkeit, zur Verringerung der Entglasungsneigung des Glases und zur Verringerung seiner Dichte bei. Der Gehalt an Al₂O₃ liegt bei 10,0 bis 25,0 %, vorzugsweise bei 15,0 bis 23,0 %. Sinkt der Gehalt auf unter 10,0 %, so steigt die Neigung zur Entglasung und es können sich durch Entglasung entstandene Verunreinigungen in Form von Cristobalit im Glas niederschlagen. Außerdem sinkt Glasübergangstemperatur. Übersteigt der andererseits 25,0 %, dann sinkt die Widerstandsfähigkeit gegen gepufferte Fluorwasserstoffsäure und es kommt leicht zu Oberflächentrübungen des Glassubstrates. Darüber hinaus steigt auch die Viskosität des Glases bei hohen Temperaturen an und die Schmelzbarkeit verschlechtert sich.

10

15

20

25

30

 B_2O_3 dient als Schmelzmittel dazu, die Viskosität zu senken und die Schmelzbarkeit zu erhöhen. Der Gehalt an B_2O_3 beträgt 3,0 bis 15,0 %, vorzugsweise 6,5 bis 15,0 % und besonders bevorzugt 8,5 bis 15,0 %. Liegt der B_2O_3 -Anteil bei unter 3,0 %, erfüllt das B_2O_3 seine Funktion als Schmelzmittel nur mehr unzureichend und die Widerstandsfähigkeit gegen gepufferte Fluorwasserstoffsäure sinkt. Übersteigt der Gehalt 15,0 %, dann sinkt die Glasübergangstemperatur derart, daß die Wärmebeständigkeit beeinträchtigt wird. Außerdem sinkt dann auch die Widerstandsfähigkeit gegen Säuren.

MgO wird beigesetzt, um zur besseren Schmelzbarkeit des Glases die Viskosität bei hohen Temperaturen zu verringern, ohne daß dabei die Glasübergangstemperatur sinkt. Außerdem ist MgO dasjenige zweiwertige Erdalkalioxid, das die größte Wirkung hinsichtlich einer Verringerung der Dichte besitzt. Ein hoher Gehalt an MgO ist jedoch insofern von Nachteil, als er die Neigung zur Entglasung erhöht. Der Anteil an MgO beträgt deshalb 0 bis 2,9 %, vorzugsweise 0 bis 1 %.

10

15

20

Wie MgO verringert auch CaO die Viskosität bei hohen Temperaturen, die Glasübergangstemperatur ohne senken, und erhöht somit die Schmelzbarkeit des Glases. Der Gehalt an CaO beträgt 0 bis 8,0 %, vorzugsweise 1,8 bis 7,5 % und besonders bevorzugt 2,1 bis 7,5 %. Ein Gehalt von über 8,0 % ist unvorteilhaft, da dann die Widerstandsfähigkeit des Glases gegen gepufferté Fluorwasserstoffsäuren beträchtlich sinkt. Insbesondere wenn das Glas einer Behandlung mit gepufferten Fluorwasserstoffsäuren unterzogen wird, schlägt sich ein große Menge eines Produkts der Reaktion zwischen dem im Glas vorhandenen CaO-Anteil und der gepufferten Fluorwasserstoffsäure an der Oberfläche des Glases nieder und es kommt leicht zu einer Trübung des Glassubstrats. Außerdem ist auch eine Verunreinigung der auf dem Glassubstrat ausgeformten Elemente sowie der chemische Lōsung durch das Reaktionsprodukt zu erwarten.

25

30

Der BaO-Anteil dient dazu, die chemische Widerstandsfähigkeit des Glases und seine Beständigkeit gegen Entglasung zu erhöhen. Der Gehalt an BaO beträgt 0,1 bis 5,0 %, vorzugsweise 0,1 bis 4,5 %. Liegt der Gehalt bei unter 0,1 %, ist es schwierig die genannte Wirkung zu

erzielen. Ein Gehalt von über 5,0 % bringt den Nachteil mit sich, daß sich die Dichte des Glases erhöht.

Wie BaO dient auch SrO dazu, die chemische Widerstandsfähigkeit des Glases und seine Beständigkeit gegen Entglasung zu erhöhen. Anders als beim BaO wird dabei die Schmelzbarkeit jedoch kaum beeinträchtigt. Ein hoher Gehalt an SrO ist insofern von Nachteil, als dadurch die Dichte des Glases erhöht wird. Deshalb beträgt der Gehalt an SrO 0,1 bis 10,0 %, vorzugsweise 1,0 bis 9,0 %.

5

10

15

20

25

30

Der Gehalt an SrO beträgt 0,1 bis 15,0 %, vorzugsweise 3,5 bis 15,0 % und besonders bevorzugt 5,0 bis 15,0 %. Liegt der Gehalt bei unter 0,1 %, dann läßt sich die oben genannte Wirkung nur mehr schwer erzielen. Andererseits ist ein Anteil von über 15,0 % insofern von Nachteil, als er zu einer höheren Dichte des Glases führt.

ZnO dient zur Verbesserung der Schmelzbarkeit und der Widerstandsfähigkeit gegen gepufferte Fluorwasserstoffsäuren. Der Gehalt an ZnO beträgt 0 bis 5,0 %. Wenn der Gehalt 5,0 % übersteigt, neigt das Glas zur Entglasung. Außerdem sinkt die Glasübergangstemperatur derart ab, daß die Wärmebeständigkeit beeinträchtigt wird.

Im übrigen führt ein Gesamtgehalt an MgO, CaO, SrO, BaO und ZnO von unter 5,0 % dazu, daß die Viskosität bei hohen Temperaturen ansteigt, wodurch die Schmelzbarkeit abnimmt und das Glas zur Entglasung neigt. Andererseits ist ein Gesamtgehalt an MgO, CaO, SrO, BaO und ZnO von mehr als 20,0 % nachteilig, da sich dadurch die Dichte des Glases erhöht

ZrO₂ verbessert die chemische Widerstandsfähigkeit und zwar insbesondere die Hitzebeständigkeit des Glases und erhöht außerdem durch Verringerung der Viskosität bei hohen Temperaturen seine Schmelzbarkeit. Der Gehalt an ZrO₂ beträgt 0 bis 5,0 %, vorzugsweise 0,1 bis 4,0 %. Übersteigt der Gehalt 5,0 %, so steigt die Entglasungstemperatur derart an, daß es leicht zu einem Niederschlag des Entglasungsprodukts Zirkon kommt.

10

15

20

25

30

5

Auch TiO2 dient zur Verbesserung der chemischen Widerstandsfähigkeit und zwar insbesondere der Widerstandsfähigkeit gegenüber Säuren. Außerdem verringert TiO2 die Viskosität bei hohen Temperaturen und erhöht damit die Schmelzbarkeit und es verhindert eine Verfärbung aufgrund ultravioletter Strahlung. Flüssigkristallanzeigeeinheiten werden während ihrer Herstellung manchmal mit ultraviolettem Licht strahlt, um organische Substanzen vom Glassubstrat zu entfernen. Bine Verfärbung des Glassubstrats durch ultraviolette Strahlen ist jedoch nachteilig, weil sie die Lichtdurchlässigkeit verringert. Es ist demnach wünschenswert, daß das verwendete Glassubstrat durch ultraviolette Strahlung nicht verfärbt wird. Ein Gehalt von TiO2 von über 5,0 % ist andererseits insofern von Nachteil, als das Glas dann ebenfalls zur Verfarbung neigt. Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es auch möglich, andere Bestandteile als die oben beschriebenen zuzusetzen, solange dies die Eigenschaften des Glassubstrats nicht beeinträchtigt. So ist es beispielsweise moglich, als Klärmittel Bestandteile wie etwa As₂03, $\mathrm{Sb_2O_3}$, $\mathrm{F_2}$, $\mathrm{Cl_2}$, $\mathrm{SO_3}$ und $\mathrm{SnO_2}$ und auch Metallpulver wie Al und Si hinzuzufügen.

Allerdings ist es nicht wünschenswert, daß das Glas Alkalimetalloxid enthält, da dies die Eigenschaften der verschiedenen auf dem Glassubstrat ausgeformten Schichten oder Halbleiterelemente verschlechtert.

5

Das üblicherweise als Schmelzmittel verwendete PbO führt zu einer erheblichen Verschlechterung der chemischen Widerstandsfähigkeit des Glases und bringt den Nachteil mit sich, das es während des Schmelzens von der Oberfläche der Schmelze verdunsten und dann die Umwelt belasten kann.

10

Auch P_5O_2 wird normalerweise als Schmelzmittel eingesetzt. P_2O_5 besitzt allerdings den Nachteil, daß es zu einer Phasentrennung des Glases führt und dessen chemische Widerstandsfähigkeit beträchtlich verringert.

15

Wird CuO beigegeben, so verfärbt sich das Glas und kann dann nicht als Glassubstrat für eine Anzeigeeinheit verwendet werden.

20

Im folgenden wird das erfindungsgemäße alkalifreie Glassubstrat unter Bezugnahme auf spezifische Beispiele noch näher beschrieben.

25

In den Tabellen 1 bis 3 sind erfindungsgemäße Glasproben (Proben Nr. 1 bis 10) sowie Vergleichsglasproben (Proben Nr. 11 bis 14) aufgeführt.

30

Jede in den Tabellen aufgeführte Probe wurde wie folgt vorbereitet. Zuerst wurde Glasmaterial mit der in den Tabellen genannten Zusammensetzung vorbereitet. Das Glasmaterial wurde dann in einem Platinschmelztiegel gegeben und bei einer Temperatur von 1.580 °C für 24

10

15

20

25

30

Stunden geschmolzen. Danach wurde das geschmolzene Glasmaterial auf eine Kohlenstoffplatte gegossen und zu einer Platte geformt.

Wie aus den Tabellen hervorgeht, besaß jede erfindungsgemäße Probe Nr. 1 bis 10 eine Dichte von höchstens 2,51 g/cm³ und eine Glasübergangstemperatur von wenigstens 668 °C. Die Proben Nr. 1 bis 10 zeigten eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Salzsäure und gepuffere Fluorwasserstoffsäure sowie eine äußerst hohe Beständigkeit gegen Entglasung. Außerdem war bei jeder der Proben 1 bis 10 die einer Viskosität von 10²,5 Poise entsprechende Temperatur hochstens 1.625 °C. Somit zeigte jede der erfindungsgemäßen Proben Nr. 1 bis 10 ausgezeichnete Eigenschaften.

Dagegen zeigte die Vergleichsprobe Nr. 11 einen geringeren Widerstand gegen Entglasung. Probe Nr. 12 wies eine schlechtere chemische Widerstandsfähigkeit und einen geringen Entglasungswiderstand auf. Probe Nr.13 besaß eine hohe Dichte. Probe Nr. 14 zeigte einen geringen Entglasungswiderstand und die Temperatur bei 10^{2,5} Poise war so hoch, daß hier nur eine schlechte Schmelzbarkeit vorhanden war.

Die in den Tabellen genannte Dichte wurde im bekannten Verfahren nach Archimedes ermittelt. Die Glasübergangstemperatur wurde nach dem ASTM-C336-71-Verfahren gemessen.

Die Widerstandsfähigkeit gegen Salzsäure wurde danach bewertet, in welchem Zustand sich die Glassubstratoberfläche befand, nachdem jede Probe optisch poliert und bei 80 °C für 24 Stunden in eine 10 Gew.-%ige Salzsäure

10

15

20

25

30

eingetaucht wurde. Die Widerstandsfähigkeit gegen gepufferte Fluorwasserstoffsäure wurde gemäß dem Zustand bewertet, den die Glassubstratoberfläche aufwies, nachdem jede Probe optisch poliert und bei 20°C für 30 Minuten in eine gepufferte Fluorwasserstoffsäurelösung mit einem Gewichtsanteil von 38,7 % Ammoniumfluorid und 1,6 % Fluorwasserstoffsäure eingetaucht wurde. Die Symbole \times , \triangle bzw. O stehen dabei für das Vorhandensein von Trübungen oder Sprüngen auf der Glassoberfläche, für eine geringe Eintrübung bzw. für das Fehlen einer Veränderung.

Die Beständigkeit gegen Entglasung wurde bestimmt, indem von jeder Probe Glaspulver mit einer Partikelgröße von 300 bis 500 µm entnommen und zur Wärmebehandlung bei 1.100°C für 100 Stunden in eine Platinwanne gelegt wurde, wobei man die Entglasung beobachtete. Die Symbole X bzw. O stehen für das Eintreten einer selbst geringfügigen Entglasung bzw. für das fehlende Eintreten einer Entglasung.

Mit "10^{2,5}-Poise-Temperatur" ist die Temperatur gemeint, die einer Viskosität bei hohen Temperaturen von 10^{2,5} Poise entspricht. Je niedriger diese Temperatur ist, desto besser ist die Schmelzformbarkeit.

Wie bereits beschrieben, betrifft die vorliegende Erfindung ein alkalifreies Glassubstrat, das im wesentlichen kein Alkalimetalloxid enthält, eine sehr hohe Wärmebeständigkeit und chemische Beständigkeit sowie eine ausgezeichnete Schmelzformbarkeit aufweist und eine geringe Dichte von höchstens 2,55 g/cm³ besitzt.

Das erfindungsgemäße alkalifreie Glassubstrat kann, wie bereits erwähnt, als Substrat für Anzeigeeinheiten, wie etwa eine Flüssigkristallanzeigeeinheit oder eine KL-Anzeigeeinheit, für einen Filter, einen Sensor und ähnliches verwendet werden und ist besonders als Glassubstrat für Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeigeeinheiten mit Dünnschichttransistoren geeignet, die nur ein geringes Gewicht besitzen dürfen.

Tabelle 1

05 198 80 967 71

								{G	ew. %)		
Probe Nr.		erfindungsgemäße Proben						(30,13)			
Zusammensetzung	1	2	3		4	5	6	7	. 8		
siO ₂	60.	0 6L	0 59.	9 62.	5	54. 0	61.5	61.0	63.	0	
A 1 2 0 3	17. (9.0 11.0				21. 0 19. 0 6. 5 7. 5		13. 5	17. (0	
Б ₂ О ₃	9. 0							.8.5	5 10.0	10. 0	
MgO		0.5	-	1.	1.5 0.5		1.0	<u> </u>	-		
CaO	5. 5	3.5	2.1	6.	0	7. C	3.0	2.5	7. 5		
ВаО	4.0	1.0	3.5	1. 7.	5	0.5	0. 5	2.0	0. 5		
SrO	3.5	2.0	6.5		- 1	0.5	5.0	9.0	1.0		
ZnO	0.5	1.0	05	-		-	1. 0	-	CVI.0		
ZrO ₂	0. 5	2.0	1.0	-		-	_	1.5	-	7	
тіО ₂		_	1.0	0.5	-	-	1. 5	2.0	-		
Dichte_(g/cm ²)	2-50	-240	2.51	2.4	5 2.	39	2. 46	2. 5[2. 39		
Glasübergangs- temperatur (°C)	681	689	676	691	7	19	571	. 668	670		
Widerstandsfähigkeit gegen Salzsäure	0	0	0	0		D -	0	0	0	ļ	
Widerstandsfähigkeit gegen gepufferte Fluorwasserstoffsäure	0	0	0	0	1. 6		0	0	С		
Beständigkeit gegen Entglassung	0	.0	0	0	C		0	0	.C		
10 ^{2.5} Poise- Temporatur (°C)	1592	1611	1604	1621	162	23	1625	1505	1594	-	

Tabelle 2

	Probe Nr.	erfindung gemäße Proben					
	Zusammensetzung	9)• 	10			
	SiO ₂	i 0 ₂			61.5		
	A 1 2 03		19.	0	18.5		
	B ₂ O ₃		8.	5	9. 0		
	MgO		0. 2	2	_		
	CaO		6. 8		3. 0		
	ВаО		0. 5		0.5		
	SrO.		1.0		5.0		
	ZnO				1.0	•	
Z r O ₂			/ 0.5		0. 5		
	T i O2		-		1.0		
	Dichte (g/cm ³)	2	2. 39		2. 45		
Glasübergangs- temperatur (°C)			701		668		
	Widerstandsfähigkeit gegen Salzsäure	(0		0		
	Widerstandsrähigkeit gegen gepufferte Fluorwasserstoffsäure	(0		0		
	Beständigkeit gegen Entglasung	(0		0		
10 ^{2,5} Poiso- Temperatur (°C)			93 1		525	•	
		_					

(Gew. %)

							(Gew	7 : 3	
Probe Nr.	ľ	Vergleichsproben							
Zusammensetzung		11		12		13		1 4	
SiO ₂		51.0	62	5	61, 0		69. 0		
A12 03		3. 0	18. 5		15.0		11.5		
B ₂ O ₃		. 5	6.	5	5. 0		5, 5		
MgO	5.	0	2. (2. 0		2. 5		1. 0	
CaO	4.	5	6. 5		3.0		4. 0		
ВаО	4.	0	-		7. 0		4.0		
Sr0	2.	0	4. 0		5.0		3. 0		
ZnO		0.	· -		1.5		2. 0		
ZrO ₂	_	-	-		_		_		
TiO2	_		-		-		-		
Dichte (g/cm ³)	2.5	4	2. 47	2. 63			2. 50		
Glasübergangs- temperatur (°C)	65	0	682	 	697		660		
Widerstandsfähigkeit ∕gegen Salzsäure	0		Δ	,	0		0		
Widerstandsfähigkeit gegen gepufferte Fiuorwasserstoffsäure	0		×	0			0		
Beständigkeit gegen Entglasung	×		×	.0			×		
10 ^{2,5} Poise- Temperatur (°C)	1570	1	1507	16	20	1	705		

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein alkalifreies Glasssubstrat, das im Wesenltichen kein Alkalimetalloxid enthält, eine hohe chemische Widerstandsfähigkeit, eine hohe Glasübergangstemperatur und eine ausgezeichnete Schmelzbarkeit und Beständigkeit gegen Entglasung besitzt, wobei das alkalfreie Glassubstrat im wesentlichen kein Alkalimetalloxid enthält und im wesentlichen aus den folgenden Gewichtsanteilen besteht: 58,0 bis 68,0 % SiO₂, 10,0 bis 25,0 % Al₂O₃, 3,0 bis 15,0 % B₂O₃, 0 bis 2,9 % MgO, 0 bis 8,0 % CaO, 0,1 bis 5,0 % BaO, 0,1 bis 10,0 % SrO, 0 bis 5,0 % ZrO₂ und 0 bis 5,0 % TiO₂.

15

10

Patentanspruch

1. Alkalifreies Glassubstrat, bestehend im wesentlichen aus den folgenden Gewichtsanteilen: 58,0 bis 68,0 % SiO₂, 10,0 bis 25,0 % Al₂O₃, 3,0 bis 15,0 % B₂O₃, 0 bis 2,9 % MgO, 0 bis 8,0 % CaO, 0,1 bis 5,0 % BaO, 0,1 bis 10,0 % SrO, 0 bis 5,0 % ZrO₂ und 0 bis 5,0 % TiO₂, wobei dieses Substrat im wesentlichen kein Alkalimetalloxid enthält.

10